

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

ในวิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการศึกษาผลตอบสนองทางแสง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระแสแอมป์ซิมของโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิด GaAlAs/GaAs โดยการออกแบบโครงสร้างมี จุดประสงค์เพื่อช่วยลดกระแสแอมป์ซิมของพาหะที่เกิดภายในระยะแอมป์ซิมนับจากขอบของชั้น ทำงาน อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของสัญญาณเอาต์พุตของโฟโตไดโอดในเชิง เวลา และทำให้ค่าความเร็วในการตอบสนองของโฟโตไดโอดคลคลง โฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิดที่ ทำการออกแบบ มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 โครงสร้าง ได้แก่

- 1) Pin Photodiode เป็นโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิดที่มีโครงสร้างซับซ้อนน้อยที่สุด อัน ประกอบด้วย ชั้นหน้าต่างหลัก (MWL) $P^+ - Ga_{0.8}Al_{0.2}As$ ชั้นทำงาน $n^- - GaAs$ และแผ่น ฐาน $n^+ - GaAs$ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับผลตอบสนองทางแสงของโฟโต ไดโอดโครงสร้างอื่นๆ
- 2) PPin Photodiode เป็น โครงสร้างที่มีชั้นรับแสงสองชั้น ประกอบด้วยชั้นหน้าต่างหลัก $P^+ - Ga_{0.8}Al_{0.2}As$ และชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้น (SWWL) $P^+ - Ga_{0.6}Al_{0.4}As$ ที่ทำหน้าที่กัน พาหะส่วนที่ทำให้เกิดกระแสแอมป์ซิมทางด้านความยาวคลื่นสั้นให้ออกห่างจากหัวต่อ และภายในชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้นก็มีอัตราการเกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลต่ำมาก
- 3) PPin Photodiode เพื่อขจัดกระแสแอมป์ซิมจากแผ่นฐานจึงออกแบบให้มีการแทรกชั้น สารที่มีค่าช่องว่างพลังงานกว้าง เช่น $N^+ - Ga_{0.6}Al_{0.4}As$ ระหว่างชั้นทำงานและแผ่นฐาน เรียกว่าชั้นหน้าต่างแสงคลื่นยาว (LWWL) โดยในโครงสร้างนี้กำหนดให้ชั้นหน้าต่าง แสงคลื่นยาวเติมสารเจือ Te-doped 10^{18} cm^{-3} ซึ่งมีความเข้มข้นของการเติมสารเจือ เท่ากับแผ่นฐาน
- 4) PPin Photodiode กำหนดให้ชั้นหน้าต่างแสงคลื่นยาวเป็น $N^- - Ga_{0.6}Al_{0.4}As$, Sn-doped 10^{15} cm^{-3} ซึ่งมีความเข้มข้นของการเติมสารเจือเท่ากับชั้นทำงาน ในกรณีนี้ชั้นทำงาน ของโฟโตไดโอดจะครอบคลุมทั้งของ $n^- - GaAs$ และ $N^- - Ga_{0.6}Al_{0.4}As$ จึงทำให้ชั้นทำงาน ของโครงสร้างนี้กว้างกว่าโครงสร้างอื่นๆ เพื่อให้ค่าความจุไฟฟ้ามีค่าน้อยลง จึงน่าจะ ส่งผลให้ความเร็วในการตอบสนองของโฟโตไดโอดโครงสร้างนี้ดียิ่งขึ้น

การคำนวณผลตอบสนองทางแสง แบ่งพิจารณาเป็นสองกรณีคือ

บทบาทของชั้นทำงาน การออกแบบความหนาชั้นทำงานให้เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อ ค่าความเร็วในการตอบสนองของโฟโตไดโอด ดังนั้นจึงทำการเพิ่มหรือลดความหนาของชั้นทำงาน

3 ค่า ที่ 0.5, 1 และ 1.5 μm แนวโน้มโดยรวมพบว่า การเพิ่มความหนาชั้นทำงานจะไม่มีผลต่อปริมาณกระแสแอมป์จิมจากชั้นหน้าต่างด้านบน แต่จะส่งผลให้กระแสแอมป์จิมจากแผ่นฐานหรือชั้นหน้าต่างใกล้แผ่นฐานลดลง ในขณะที่กระแสพัคพาในชั้นทำงานและกระแสสุทธิเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าโครงสร้างที่มีชั้นทำงานบางๆ จะได้รับผลกระทบจากกระแสแอมป์จิมจากแผ่นฐานมากกว่าโครงสร้างที่มีชั้นทำงานหนาๆ สังเกตได้จากความแตกต่างของค่ากระแสพัคพาและกระแสสุทธิ

ในแง่ของการวิเคราะห์หาโครงสร้างที่ดีที่สุดที่จะช่วยขจัดกระแสแอมป์จิมที่ขอบทั้งสองด้านของชั้นทำงาน พบว่าโครงสร้างที่มีชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้น อาทิ PPi_n, PPi_nN และ PPi_nN Photodiode จะสามารถขจัดกระแสแอมป์จิมจากชั้นรับแสงได้ เนื่องจากชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้นมีช่องว่างแถบพลังงานสูงกว่าชั้นหน้าต่างหลัก จึงมีกำแพงพลังงานที่สามารถปิดกั้นการแพร่จิมของพาหะส่วนที่เกิดในชั้นหน้าต่างหลักได้ นอกจากนี้จากการคำนวณอัตราการเกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลพบว่าแทบไม่มีพาหะไฟฟ้าเกิดขึ้นเลยในชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้น จึงไม่มีพาหะจากชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้นดังกล่าวแพร่จิมไปยังชั้นทำงานได้ ส่วนกรณีกระแสแอมป์จิมจากแผ่นฐานหรือชั้นหน้าต่างแสงคลื่นยาวใกล้แผ่นฐาน พบว่าโครงสร้าง PPi_nN Photodiode จะมีกระแสส่วนนี้ น้อยที่สุด เนื่องจากสนามไฟฟ้าของชั้นทำงานอยู่ห่างจากแผ่นฐานเป็นระยะเท่ากับความหนาของชั้นหน้าต่างแสงคลื่นยาว และในชั้นหน้าต่างแสงคลื่นยาวก็มีอัตราการเกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลต่ำมาก ๆ จนถือได้ว่าไม่มีพาหะจากชั้นหน้าต่างนี้แพร่จิมไปยังชั้นทำงาน สำหรับโครงสร้าง PPi_nN Photodiode ชั้นทำงานจะเข้ามาประชิดแผ่นฐานจึงป้องกันกระแสแอมป์จิมส่วนนี้ไม่ได้

โดยสรุปแล้ว โครงสร้าง PPi_nN Photodiode เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุด ในแง่ช่วยปรับปรุงความเร็วในการตอบสนองของโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิด ด้วยการขจัดกระแสแอมป์จิมที่ขอบทั้งสองด้านของชั้นทำงาน อันเป็นที่มาของผลตอบสนองทางแสงที่ขอบด้านความยาวคลื่นสั้นและความยาวคลื่นยาว

บทบาทของชั้นหน้าต่างหลัก อาศัยหลักการที่ว่า การเพิ่มความหนาให้กับชั้นหน้าต่างหลักให้พอเหมาะ จะช่วยขจัดผลตอบสนองทางแสงที่ขอบด้านความยาวคลื่นสั้นอันเกิดเพราะกระแสแอมป์จิมจากชั้นรับแสงได้มากขึ้น สรุปจากการคำนวณผลตอบสนองทางแสงพบว่า โครงสร้างที่มีชั้นหน้าต่างแสงคลื่นสั้น (PPi_n Photodiode) โดยที่ให้ชั้นหน้าต่างหลักหนาขึ้นจะ ช่วยขจัดกระแสแอมป์จิมจากชั้นรับแสงได้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นจึงมีผลตอบสนองทางแสงที่ขอบด้านความยาวคลื่นสั้นน้อยที่สุด

ในส่วนของการทดลองจะเน้นศึกษาบทบาทของชั้นหน้าต่างหลัก โดยทำการผลิตโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิดด้วยเทคนิคเอพิแทกซ์สถานะของเหลวทั้งหมด 3 โครงสร้าง ซึ่งมีชั้นทำงาน n⁻-GaAs และแผ่นฐาน n⁺-GaAs เหมือนกัน

- 1) โครงสร้างที่ 1 คือ Pin Photodiode มีชั้นหน้าต่างหลักเป็น $P^+ - Ga_{0.8}Al_{0.2}As$ หนา $1 \mu m$
- 2) โครงสร้างที่ 2 คือ PPin Photodiode ภาพตัดขวางจริงของโครงสร้างถ่ายจาก SEM พบว่ามีชั้นหน้าต่างหลักเป็น $P^+ - Ga_{0.8}Al_{0.2}As$ หนา $0.5 \mu m$ และชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้น $P^+ - Ga_{0.6}Al_{0.4}As$ หนา $0.5 \mu m$
- 3) โครงสร้างที่ 3 คือ PPin Photodiode ภาพตัดขวางถ่ายจาก SEM พบว่ามีชั้นหน้าต่างหลักเป็น $P^+ - Ga_{0.8}Al_{0.2}As$ หนา $0.8 \mu m$ และชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้น $P^+ - Ga_{0.6}Al_{0.4}As$ หนา $0.2 \mu m$

ผลตอบสนองทางแสงของทั้งสามโครงสร้างมีค่าสูงในช่วงความยาวคลื่นใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 743-875 nm แต่จะเห็นว่าผลการทดลองที่ได้มีความแตกต่างกับผลการคำนวณอยู่บ้าง สาเหตุหลักเป็นผลจากประสิทธิภาพเชิงควอนตัมจริงมีค่าต่ำกว่า 1 ในช่วงความยาวคลื่นสั้น ประสิทธิภาพเชิงควอนตัมมีค่าต่ำเนื่องจากศูนย์รวมตัวใกล้รอยต่อพี-เอ็น และในช่วงความยาวคลื่นยาว ประสิทธิภาพเชิงควอนตัมมีค่าต่ำเนื่องจากสนามไฟฟ้าตกคร่อมไม่เต็มย่านทำงานตามโครงสร้าง อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้จากการทดลองพบว่าโครงสร้างที่ 3 มีผลตอบสนองทางแสงในย่านความยาวคลื่นสั้นต่ำที่สุด ถึงแม้ว่าชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นจะมีความหนาน้อยกว่าความยาวแพร่ซึมของอิเล็กตรอนก็ตาม เนื่องจากอิทธิพลของกำแพงพลังงานระหว่างชั้นหน้าต่างหลักและชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นจะสามารถกั้นพาหะที่เกิดในชั้นหน้าต่างหลักมิให้แพร่ซึมเข้ามายังชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นได้ อีกทั้งอัตราการเกิดคู่อิเล็กตรอนโฮลในชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นเองยังมีค่าต่ำมากอีกด้วย จึงถือว่าไม่มีพาหะจากชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นแพร่ซึมมายังย่านทำงาน

สรุปได้ว่าแนวโน้มที่ได้จากการทดลองมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบโครงสร้าง นั่นคือการใช้โครงสร้างโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิดที่มีชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นจะสามารถช่วยขจัดกระแสแพร่ซึม อันเป็นผลต่อผลตอบสนองทางแสงที่ขอบด้านความยาวคลื่นสั้นได้ และหากเพิ่มความหนาของชั้นหน้าต่างหลักอย่างเหมาะสม จะทำให้ชั้นหน้าต่างหลักดูดกลืนแสงที่มีพลังงานสูงได้มากขึ้น แสงที่มีพลังงานสูงดังกล่าวก็จะทะลุไปยังชั้นหน้าต่างแสงคลิ่นสั้นได้น้อยลง ทำให้ผลตอบสนองทางแสงที่ขอบด้านความยาวคลื่นสั้นมีค่าน้อยที่สุด

6.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) สามารถนำหลักการในการออกแบบโครงสร้างโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิด GaAlAs/GaAs ที่ได้นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ ไปใช้ออกแบบโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิดที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำชนิดอื่นได้ด้วย

- 2) เพื่อศึกษาผลของกระแสแอมป์ซิมที่มีต่อความเร็วในการตอบสนองของโฟโตไดโอดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงอาจเพิ่มการคำนวณผลตอบสนองทางความถี่ของโฟโตไดโอดหัวต่อต่างชนิดในโครงสร้างต่างๆที่ทำการออกแบบด้วย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย